ное развитие процесса ассоциации, поскольку ионные пары обладают большим дипольным моментом. При добавлении в раствор HCl равновесие смещается в сторону образования ионов ЭК, что способствует неизменности спектров поглощения разбавленных растворов и уменьшению степени ассоциации концентрированных растворов.

Таким образом, полученные данные позволяют считать, что в водных растворах ЭК ассоциация происходит между его ионными парами, а причины, вызывающие изменение его спектров поглощения при добавлении в раствор электролита, сводятся к эффекту высаливания и изменению в нем концентрации ионных пар.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Вапоч А. V. Über den Einfluss der Temperatur auf die Fluorescenzauslösung der Farbstafflösungen durch Elektrolyte.— Z. Phys. Chem., 1933, 163, р. 172—184. [2] Банов А. В. О тушении флуоресценции растворов красящих веществ электролитами (II).— Журн. физ. химин, 1934, 5, № 1, с. 46—51. [3] Левшин В. Л., Баранова Е. Г. Природа концентрационных эффектов в растворах родаминов.— Изв. АН СССР, сер. физич., 1956, 20, № 4, с. 424—432. [4] Perrin F. L'association moléculairect l'optimum de fluorescence des Solutions. Influence des sels.— Сотрт. Rend. Acad. Sci., 1937, 192, р. 1727—1729. [5] Семенченко В. К. Физическая теория растворов. М.—Л.: Гостехиздат, 1941, 344 с. [6] Левшин Л. В., Головина А. П., Бобровская Е. А. Спектроскопическое изучение влияния различных анионов на развитие ассоциации молекул красителя родамина 6Ж.— Вестн. Моск. ун-та. Сер. Физ. Астрон., 1966, № 3, с. 67—75.

Поступила в редакцию 26.12.80

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1981, Т. 22, № 6

УДК 539.163:539.211

АКТИВАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ИОННОГО ВНЕДРЕНИЯ

Ю. В. Булгаков, Л. М. Савельева

(HИИЯФ)

Метод радиоизотопных индикаторов нашел широкое применение в различных областях науки и техники, в частности в машиноведении, где он используется для контроля износа деталей пар трения Важнейшей составной частью радиоизотопного метода является несение радиоактивных меток на исследуемые объекты. Метка не должна изменять физико-механических свойств активируемого чтобы процесс износа активированных и неактивированных участков поверхности протекал с одинаковой скоростью. По этой причине оказываются малопригодными такие распространенные методы поверхностной активации, как гальванический и электроискровой. Лучшие результаты дает метод протонной активации [2], основанный на облучении исследуемых объектов протонами с энергиями порядка 10 МэВ. Под действием быстрых протонов в мишени образуются радиоактивные ядра, которые и используются в качестве индикаторов износа. Однако метод протонной активации не универсален. Он применим в основном к сплавам на основе железа. Далее, из-за большой проникающей способности протонов толщина активированного слоя составляет десятые доли миллиметра, что затрудняет использование метода при следовании начальной стадии износа, когда толщина стираемых слоев измеряется единицами микрон. Наконец, метод связан с использованием сложной ускорительной техники, что сдерживает его широкое распространение.

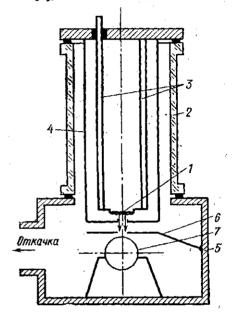
Более доступным является метод ионной активации материалов, осуществляемый путем внедрения в исследуемые образцы ускоренных радиоактивных ионов. В первоначальном варианте [3] предлагалось проводить процесс активации на электромагнитных сепараторах радиоактивных ионов. Однако установки этого типа также малодоступны, в связи с чем метод не получил распространения.

Нами был предложен более простой способ ионной активации, основанный на использовании ионов радиактивных изотопов цезия с атомными номерами 134 и 137. Известно [4], что атомы цезия легко

ионизуются на поверхности горячего вольфрама, благодаря чему для них существуют простые ионные источники с эффективностью использования рабочего вещества, близкой к 100%. Этим рещается проблема радиационной безопасности метода.

Схема установки для активации образцов ускоренными ионами зия приведена на рисунке. Установка состоит из ионного источника и вакуумной камеры, в которую навливается активируемый объект. Основной частью источника ионов является вольфрамовая лента (1),

Схема установки для ионной активации материалов. 1— вольфрамовая лента, 2— высоковольтный изолятор, 3— токоподводящие щины, 4— кожух источника, 5— вакуумная камера, 6— диафрагма, 7— активируемая деталь



покрытая спеченным порошком вольфрама. Перед экспозицией на поверхность ленты наносится капля раствора, содержащего один из указанных изотопов цезия (нами использовались водные растворы солей Cs₂SO₄ и CsCl). После откачки до давления ~1·10⁻⁵ мм рт. ст. на источник подается ускоряющее напряжение (~50—70 кэВ) и производится нагрев ленты до температуры ~1000°С. Процесс активации длится около одной минуты. Таким способом нами были получены метки на образцах из алюминия, меди, железа и на других материалах, включая полимеры. Метки обладают высокой устойчивостью к воздействию растворителей, практически растворяясь лишь вместе с основой. На образцах из стали и сплавов алюминия метки выдерживали длительный нагрев до температуры 400°С. Для изотопа ¹³⁷Cs активность метки составляла ~1·10³ распадов/с, что составляло примерно 30% активности изотопа, вводимого в ионный источник.

С помощью описанного метода в Базовой изотопной лаборатории ЗиЛа была изучена относительная износоустойчивость чугунов различных марок, обработанных излучением лазера, а также исследована динамика износа деталей поршневой группы компрессора холодильной установки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Точильников Д. Г. Радиоиндикаторные методы определения износа деталей двигателей внутреннего сгорания. Л.: Машиностроение, 1968. [2] Постим-

ков В. И. Радиоактивные изотопы в исследовании и автоматизации контроля износа. М.: Машиностроение, 1967. [3] Pinel J., Levaillant C. Tomson—CSF, патент Франции № 2133316 G 01 п. 23/00, 1972. [4] Зандберг Э. Я., Ионов Н. И. Поверхностная ионизация.—УФН, 1959, 67, № 4, с. 581—623.

Поступила в редакцию 29.12.70

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1981, Т. 22, № 6

УДК 535.544:537.721.8

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ РАЗРЯДА ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ

А. И. Нагаев, В. Н. Парыгин, Л. В. Щекотуров

(кафедра физики колебаний)

Постоянная времени разряда т электрооптических кристаллов, применяемых в электронно-лучевых пространственных модуляторах света, является важной характеристикой, определяющей время хранения записанной информации. Работ, в которых проводятся прямые измерения т электрооптических кристаллов, мало (см., например, [1]).

В данной работе проведены измерения τ кристалла DKDP с содержанием дейтерия 96% в зависимости от температуры и кристалла $Bi_{12}SiO_{20}$ при температуре $t_{\tau}=2^{\circ}C$. Методики измерения основаны на

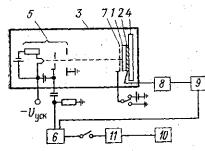


Рис. 1. Схема установки для измерения постоянной времени разряда кристаллов

определении количества заряда, оставшегося на кристалле, по прошествии определенного времени. Схема установки для измерения т представлена на рис. 1.

Кристалл 1 с нанесенным с одной стороны проводящим слоем (сигнальной пластиной) 2 помещается в откачиваемый объем 3 и может охлаждаться термоэлектрическим микроохладителем 4. Заряд на кристалл наносится электронной пушкой 5, работающей в импульсном режиме. Она управляется генератором 6 и заряжает кристалл за время импульса Δt . Применяется режим равновесной записи [2]. Ускоряющее напря-

жение электронной пушки выбирается таким, что коэффициент вторичной эмиссии кристалла больше 1. В этом случае процессом заряда управляет барьерная сетка 7, расположенная вблизи поверхности кристалла. Потенциал поверхности, бомбардируемой электронным лучом, доводится за время импульса Δt до потенциала сетки. Ток заряда кристалла снимается с сигнальной пластины и через усилитель тока 8 подается на осциллограф 9. Кривая изменения зарядного тока в течение импульса Δt фотографируется с экрана осциллографа. Величина заряда равна площади под кривой зарядного тока.

Поскольку τ кристалла DKDP сильно меняется в зависимости от температуры, применялись две методики. Для малых $\tau(\tau < 10 \text{ c})$ измерения проводились по кривым зарядного тока. Для постоянных времени, превышающих 10 c — по кривым тока разряда кристалла. По первой методике измерения выполнялись следующим образом. На сетку 7 подавался положительный относительно сигнальной пластины потенциал ~ 200 В. Электронный луч диаметром 0.3 мм заряжал кристалл